

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①⑪ N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 801 206

②① N° d'enregistrement national : **99 14583**

⑤① Int Cl⁷ : A 61 K 7/42, A 61 K 7/02, 7/06

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 19.11.99.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 25.05.01 Bulletin 01/21.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : L'OREAL Société anonyme — FR.

⑦② Inventeur(s) :

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : L OREAL.

⑤④ COMPOSITIONS FILTRANTES CONTENANT L'ASSOCIATION D'UN DERIVE D'ACIDE NAPHTALENE MONO-
OU POLYCARBOXYLIQUE ET D'UN FILTRE UV DERIVE D'HYDROXYPHENYLBENZOTRIAZOLE.

⑤⑦ L'invention concerne des compositions cosmétiques à
usage topique, en particulier pour la photoprotection de la
peau et/ou des cheveux, caractérisées par le fait qu'elles
comprennent, dans un support cosmétiquement acceptable
notamment de type huile-dans-eau, (a) au moins un dérivé
d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et (b) au
moins un système photoprotecteur capable de filtrer les
rayons UV contenant au moins un filtre UV organique du
type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole.

L'invention concerne également leur application à la
protection de la peau et des cheveux contre les effets du
rayonnement ultraviolet

FR 2 801 206 - A1



**COMPOSITIONS FILTRANTES CONTENANT L'ASSOCIATION D'UN DERIVE
D'ACIDE NAPHTHALENE MONO- OU POLYCARBOXYLIQUE ET D'UN FILTRE UV
DERIVE D'HYDROXYPHENYLBENZOTRIAZOLE**

5

L'invention concerne des compositions cosmétiques à usage topique, en particulier pour la photoprotection de la peau et/ou des cheveux, caractérisées par le fait qu'elles comprennent, dans un support cosmétiquement acceptable notamment de type huile-dans-eau, (a) au moins un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et (b) au moins un système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au moins un filtre UV organique du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole.

10

L'invention concerne également leur application à la protection de la peau et des cheveux contre les effets du rayonnement ultraviolet.

15

On sait que les radiations lumineuses de longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 400 nm permettent le brunissement de l'épiderme humain et que les rayons de longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 320 nm, connus sous la dénomination d'UV-B, provoquent des érythèmes et des brûlures cutanées qui peuvent nuire au développement du bronzage naturel ; ce rayonnement UV-B doit donc être filtré.

20

On sait également que les rayons UV-A, de longueurs d'onde comprises entre 320 nm et 400 nm, qui provoquent le brunissement de la peau, sont susceptibles d'induire une altération de celle-ci, notamment dans le cas d'une peau sensible ou d'une peau continuellement exposée au rayonnement solaire. Les rayons UV-A provoquent en particulier une perte d'élasticité de la peau et l'apparition de rides conduisant à un vieillissement prématuré. Ils favorisent le déclenchement de la réaction érythémateuse ou amplifient cette réaction chez certains sujets et peuvent même être à l'origine de réactions phototoxiques ou photo-allergiques. Il est donc souhaitable de filtrer aussi le rayonnement UV-A.

30

De nombreuses compositions cosmétiques destinées à la photoprotection (UV-A et/ou UV-B) de la peau ont été proposées à ce jour.

35

Ces compositions antisolaires se présentent assez souvent sous la forme d'une émulsion de type huile-dans-eau (c'est à dire un support cosmétiquement acceptable constitué d'une phase continue dispersante aqueuse et d'une phase discontinue dispersée huileuse) qui contient, à des concentrations diverses, un ou plusieurs filtres organiques classiques, lipophiles et/ou hydrophiles, capables d'absorber sélectivement les rayonnements UV nocifs, ces filtres (et leurs quantités) étant sélectionnés en fonction du facteur de protection solaire recherché (le facteur de protection solaire (SPF) s'exprimant mathématiquement par le rapport du temps d'irradiation nécessaire pour atteindre le seuil érythématogène avec le filtre UV au temps nécessaire pour atteindre le seuil érythématogène sans filtre UV).

45

La Demanderesse a découvert, de façon inattendue et surprenante, que l'utilisation d'un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique dans une composition antisolaires comprenant au moins un filtre UV du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole, permettait d'augmenter de façon substantielle son niveau de protection vis à vis des effets induits par les radiations UV-A

50

Cette découverte est à la base de la présente invention.

Par système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV, on entend par tout système constitué d'un ou plusieurs composés organiques et/ou composés minéraux filtrant les radiations UV (UVA et/ou UV-B).

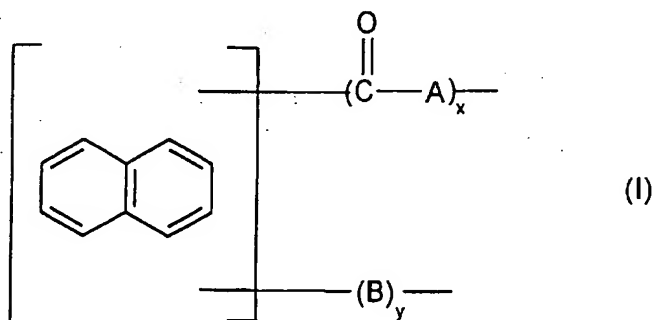
- 5 Ainsi, conformément à l'un des objets de la présente invention, il est maintenant proposé de nouvelles compositions cosmétiques ou dermatologiques, en particulier antisolaires, qui sont essentiellement caractérisées par le fait qu'elles comprennent, dans un support cosmétiquement acceptable :
- 10 (a) au moins un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et
(b) au moins un système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au moins un filtre UV organique du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole.

15 La présente invention a également pour objet l'utilisation de telles compositions pour la fabrication de compositions cosmétiques destinées à la protection de la peau et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire.

20 La présente invention a également pour objet l'utilisation d'un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique dans la préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique photoprotectrice comprenant au moins un filtre UV organique du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole, dans le but d'augmenter son niveau de protection vis à vis des effets induits par les radiations UV-A

25 D'autres caractéristiques, aspects et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre.

Les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique conformes à l'invention peuvent être choisis parmi les composés comprenant au moins un motif répondant à la structure suivante :



30

dans laquelle :

- A, identiques ou différents, désignent un groupe OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un cation M
x est un nombre de 1 à 8 ;
- 35 y est un nombre de 0 à 7 avec $x+y \leq 8$;
- B, identiques ou différents, désignent hydrogène, OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un groupe $-(C=O)R_1$;
- R_1, R_2, R_3 , identiques ou différents, désignent hydrogène ; un alkyle en C_1-C_{30} , linéaire ou ramifié acyclique ou cyclique, éventuellement interrompu par un ou plusieurs hétéroatomes et éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un alcényle en C_2-C_{30} , linéaire ou ramifié acyclique ou cyclique, éventuellement interrompu par un ou plusieurs hétéroatomes (tels que O, S, N) et éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un groupement aryle, aralkyle ou alkylaryle en C_6-C_{30} , éventuellement substitué par un ou
- 45 plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un hétérocycle en C_3-C_{12} ,

éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un halogène (tel que fluor, brome ou chlore) ; un groupe nitrile ; un groupe amino ; un groupe nitro ; un groupe cyano ; un groupe SO_3H ou SO_3M ; un groupement comportant au moins un atome de silicium ;

- 5 M représente un cation de métal alcalin, de métal alcalino-terreux, un groupe ammonium ou un reste d'amine ou d'alcanolamine quaternisée.

Parmi les composés de formule (I) connus dans l'art antérieur et utilisables conformément à l'invention, on peut citer :

10

(1) les acides naphtalène mono- ou polycarboxyliques et leurs sels tels que :

- l'acide 1-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH-catalogue 1999-2000) ;
- l'acide 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
- 15 - l'acide 1-hydroxy 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
- l'acide 2-hydroxy 1-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
- l'acide 3-hydroxy 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
- l'acide 6-hydroxy 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
- l'acide 1,4-naphtalène dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
- 20 - l'acide 2,3-naphtalène dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
- l'acide 2,6-naphtalène dicarboxylique (disponible chez ALDRICH)
- l'acide 2,6-naphtalène dicarboxylique
- l'acide 1,3-naphtalène dicarboxylique
- l'acide 1,2-naphtalène dicarboxylique
- 25 - l'acide 1,5-naphtalène dicarboxylique
- l'acide 1,6-naphtalène dicarboxylique
- l'acide 1,7-naphtalène dicarboxylique
- l'acide 2,7-naphtalène dicarboxylique
- le sel de potassium de l'acide 4-sulfo 1,8-naphtalène dicarboxylique
- 30 - l'acide 1,2,3-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,2,3-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,2,4-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,2,5-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,2,6-naphtalène tricarboxylique
- 35 - l'acide 1,2,7-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,2,8-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,3,5-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,3,7-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,3,8-naphtalène tricarboxylique
- 40 - l'acide 1,4,5-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,4,6-2-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 2,3,5-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 2,3,6-naphtalène tricarboxylique
- l'acide 1,4,5,8-naphtalène tétracarboxylique (disponible chez ALDRICH)
- 45 - l'acide 1,2,3,4-naphtalène tétracarboxylique
- l'acide 1,2,5,8-naphtalène tétracarboxylique
- l'acide 1,3,6,8-naphtalène tétracarboxylique
- l'acide 1,4,5,8-naphtalène tétracarboxylique
- l'acide 2,3,6,7-naphtalène tétracarboxylique

50

(2) les mono- ou polyesters d'acide naphtalène mono- ou polycarboxylique tels que :

- le diméthylester de l'acide 2,3-naphtalène dicarboxylique
- le diméthylester de l'acide 2,3-naphtalène dicarboxylique
- le méthylester de l'acide 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH).

(3) les mono- ou polyamides d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique tels que le diamide de l'acide 2,3-naphthalène dicarboxylique.

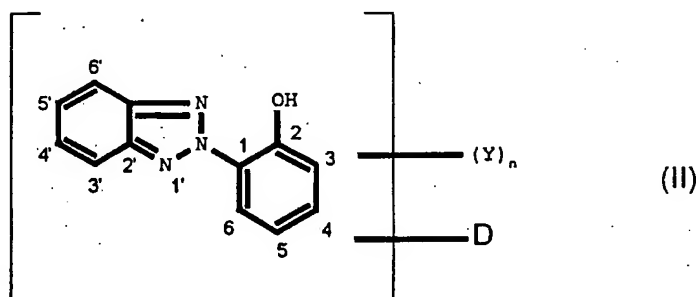
5 On utilisera plus particulièrement les dérivés d'acide naphthalène dicarboxylique à terminaisons glycols et alcools vendus sous la dénomination commerciale HALLBRITE TQ par la société C.P. HALL.

10 Les dérivés d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique conformes à l'invention sont généralement présents dans les compositions selon l'invention à une concentration totale comprise entre 0,1 et 20 % en poids environ, et de préférence entre 0,5 et 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition.

15 Les filtres UV du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole conformes à la présente invention peuvent être siliciés c'est à dire comporter dans leur structure un ou plusieurs atomes de silicium ou bien hydrocarbonés.

Parmi les dérivés siliciés d'hydroxyphénylbenzotriazole, on citera en particulier ceux répondant à la formule (II) suivante :

20

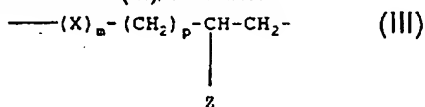


dans laquelle :

- D désigne un radical divalent -L-W-
 - Y, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en C₁-C₁₀, les halogènes, les radicaux alkoxy en C₁-C₁₀, des groupes sulfoniques, étant entendu que, dans ce dernier cas, deux Y adjacents d'un même noyau aromatique peuvent former ensemble un groupement alkylidène dioxy dans lequel le groupe alkylidène contient de 1 à 2 atomes de carbone ; sous réserve que les radicaux Y soient différents d'un groupe sulfonique quand D est différent d'hydrogène ;

30 - n vaut 1, 2 ou 3 ;

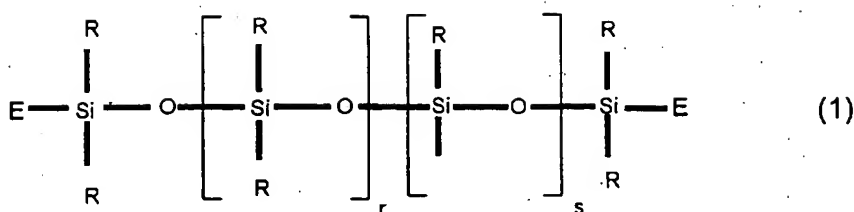
- L est un radical divalent de formule (III) suivante :



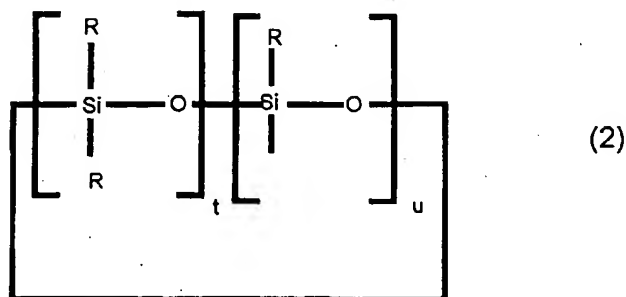
dans laquelle :

35 - X représente O ou NH,
 - Z représente l'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄,
 - n est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclusivement,
 - m est 0 ou 1,
 - p représente un nombre entier compris entre 1 et 10, inclusivement.

40 - W est un radical de formule (1), (2) ou (3) suivante :



ou



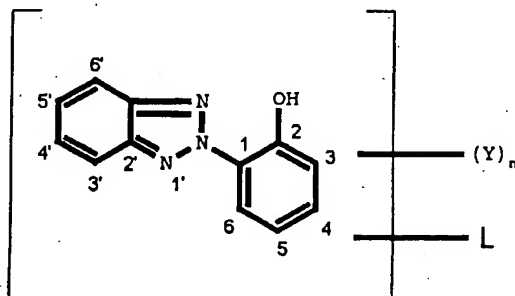
ou



dans lesquelles :

- R, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en C₁-C₁₀, phényle et trifluoro-3,3,3 propyle, au moins 80% en nombre des radicaux R étant méthyle,

- E, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux R et le radical V de formule suivante :



dans laquelle Y, n et L ont les mêmes significations indiquées ci-dessus ;

- r est un nombre entier compris entre 0 et 50 inclusivement, et s est un nombre entier compris entre 1 et 20 inclusivement, et si s=0 au moins l'un des deux radicaux B désigne V ;

- u est un nombre entier compris entre 1 et 6 inclusivement, et t est un nombre entier compris entre 0 et 10 inclusivement, étant entendu que t + u est égal ou supérieur à 3.

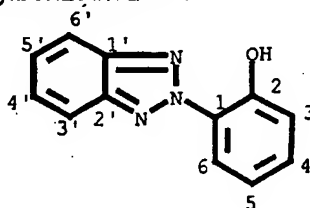
Pour les composés de formule (II), les radicaux alkyle peuvent être linéaires ou ramifiés et choisis notamment au sein des radicaux méthyle, éthyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, ter.-butyle, n-amyle, isoamyle, néopentyle, n-hexyle, n-heptyle, n-octyle, 2-éthylhexyle et tert.-octyle. Les radicaux alkyle R préférés selon l'invention sont les radicaux méthyle, éthyle, propyle, n-butyle, n-octyle et 2-éthylhexyle. Encore plus préférentiellement, les radicaux R sont tous des radicaux méthyle.

Pour les composés de formule (II), on préfère mettre en œuvre ceux où W répond à la formule (1), c'est-à-dire des polyorganosiloxanes à chaîne linéaire.

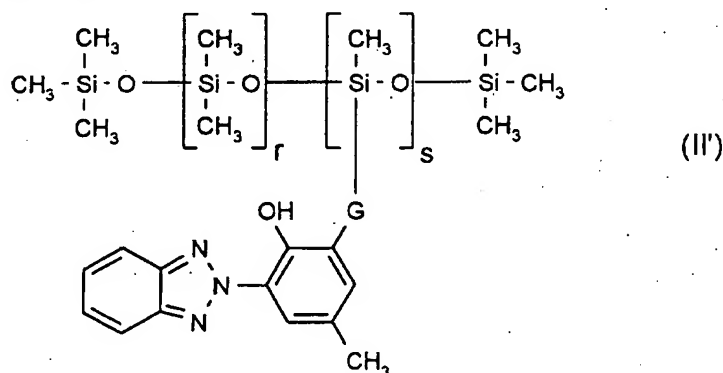
Parmi les polyorganosiloxanes linéaires rentrant dans le cadre de la présente invention, on préfère plus particulièrement les dérivés statistiques ou bien définis à blocs présentant au moins l'une, et encore plus préférentiellement l'ensemble, des caractéristiques suivantes :

- 5 - R est alkyle et encore plus préférentiellement est méthyle,
- E est alkyle et encore plus préférentiellement est méthyle,
- r est compris entre 0 et 15 inclusivement ; s est compris entre 1 et 5 inclusivement,
- n est non nul, et de préférence égal à 1, et Y est alors choisi parmi méthyle, ter-butyle ou alcoxy en C₁-C₄,
- 10 - Z est hydrogène ou méthyle,
- m=0, ou [m=1 et X=O]
- p est égal à 1.

- 15 Comme cela ressort de la formule (II) donnée ci-dessus, l'accrochage du chaînon $-(X)_m-(CH_2)_p-CH(Z)-CH_2-$ sur le motif benzotriazole, qui assure donc le raccordement dudit motif benzotriazole à l'atome de silicium de la chaîne siliconée, peut, selon la présente invention, se faire dans toutes les positions disponibles offertes par les deux noyaux aromatiques de l'hydroxyphénylbenzotriazole :



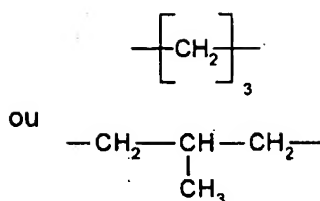
- 20 De préférence, cet accrochage se fait en position 3, 4, 5 (noyau aromatique portant la fonction hydroxy) ou 4' (noyau benzénique adjacent le cycle triazolé), et encore plus préférentiellement en position 3, 4 ou 5. Dans une forme préférée de réalisation de l'invention, l'accrochage se fait en position 3.
- 25 De même, l'accrochage du motif substituant Y peut se faire dans toutes les autres positions disponibles au sein du benzotriazole. Toutefois, de préférence, cet accrochage se fait en position 3, 4, 4', 5 et/ou 6. Dans une forme préférée de réalisation de l'invention, l'accrochage se fait en position 5.
- 30 Une famille de composés convenant particulièrement à l'invention est celle définie par la formule générale suivante :



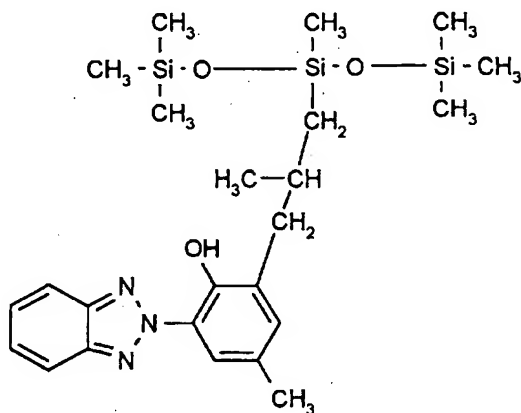
avec $0 \leq r \leq 15$, de préférence $0 \leq r \leq 10$
 $1 \leq s \leq 5$, de préférence $1 \leq s \leq 3$

35

et où G représente le radical divalent :



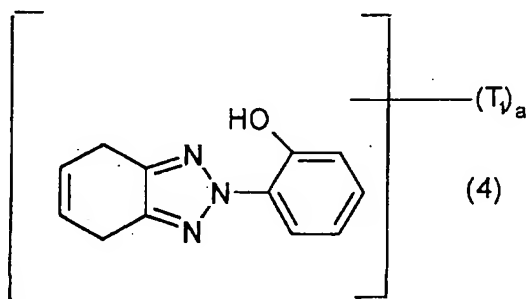
- 5 Dans une forme particulièrement préférée de réalisation de l'invention, on utilisera la silicone benzotriazole répondant à la formule générale (II') dans laquelle :



- 10 plus connue sous le nom CTFA « Drometrisole Trisiloxane » et vendue par RHODIA CHIMIE sous le nom SILATRIZOLE.

Ces dérivés siliciés d'hydroxybenzotriazole de formule (II) sont connus en soi et sont notamment décrits dans les brevets EP-B-0392 883 et EP-B-660 701.

- 15 Parmi les dérivés hydrocarbonés d'hydroxyphénylbenzotriazole conformes à l'invention, on peut citer les composés répondant à la formule suivante (4) :

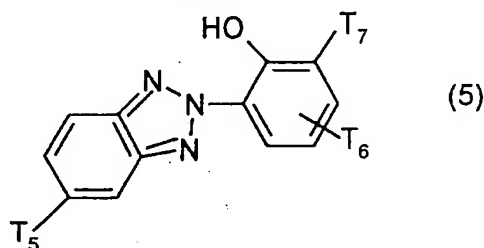


- 20 dans laquelle a vaut 1, 2 ou 3 et les radicaux T_1 , identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en C_1 - C_{18} , les halogènes, des groupes sulfoniques, les radicaux alkoxy en C_1 - C_{18} , , étant entendu que, dans ce dernier cas, deux T_1 adjacents d'un même noyau aromatique peuvent former ensemble un groupement alkylidène dioxy dans lequel le groupe alkylidène contient de 1 à 2 atomes de carbone.

25 Parmi les composés de formule (4) utilisables selon l'invention, on peut citer par exemple :

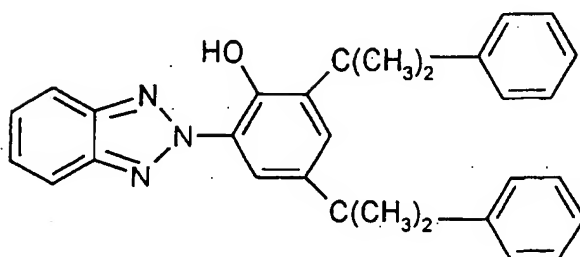
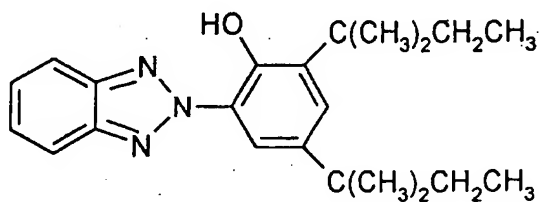
- le 2-(2'-hydroxy-5'-méthylphényl)benzotriazole ($a = 1$ et $T_1 = \text{CH}_3$), tel que le produit vendu sous le nom UVAZOL P par la société Enichem Synth, le produit vendu sous le nom TINUVIN P par la société CIBA GEIGY ;
- le 2-(2'-hydroxy-3'-butyl-5'-méthylphényl)benzotriazole ($a = 2$ et les deux groupes T_1 sont $-\text{CH}_3$ et $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) tel que le produit vendu sous le nom UVAZOL 236 par la société Enichem Synth ;
- le 2-(2'-hydroxy-5'-t-octylphényl)benzotriazole ($a = 1$ et $T_1 = -\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$) tel que le produit vendu sous le nom UVAZOL 311 par la société Enichem Synth ;
- le 2-(2'-hydroxy-3'-sec-butyl-5'-benzènesulfonate)benzotriazole ($a = 2$ et les deux groupes T_1 sont SO_3 et $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) tel que le produit vendu sous le nom CIBAFast par la société CIBA GEIGY.

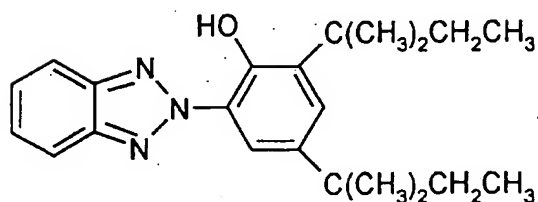
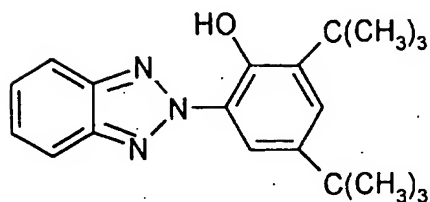
Parmi les filtres UV hydrocarbonés du type dérivé d'hydroxybenzotriazole conformes à l'invention, on peut citer en particulier ceux de formule suivante (5) tels que décrits dans la demande WO95/22959 (faisant partie intégrante du contenu de la description) :



dans laquelle T_5 désigne un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_{18}$; T_6 et T_7 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ éventuellement substitué par un phényle.

A titre d'exemple de composés de formule (5), on peut citer les produits commerciaux TINUVIN 328, 320, 234 et 350 de la Société CIBA-GEIGY de structure suivante :

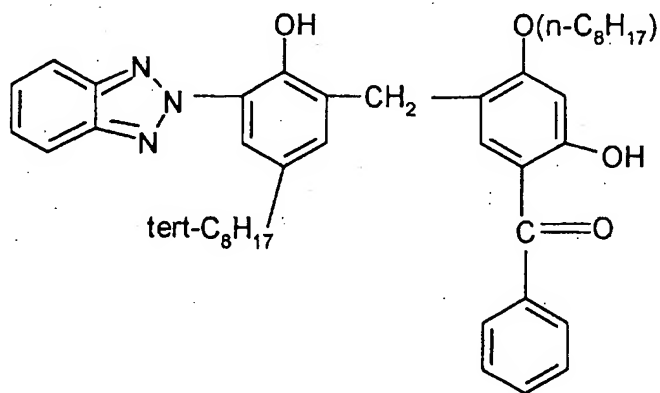




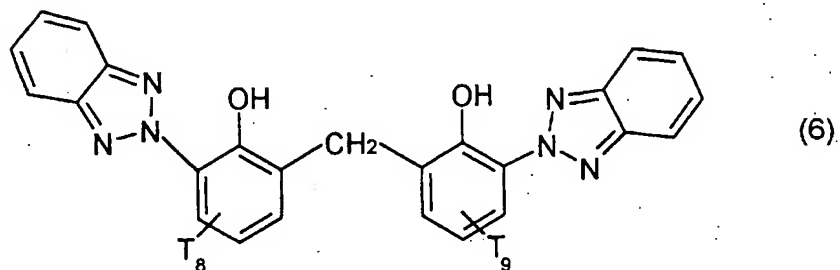
5

Parmi les filtres UV hydrocarbonés du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole conformes à l'invention, on peut citer les composés tels que décrits dans les brevets US 5 687 521, US 5 687 521, US 5 373 037, US 5 362 881 et en particulier le [2,4'-dihydroxy-

10 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-2'-n-octoxy-5'-benzoyl] diphénylméthane vendu sous le nom MIXXIM PB30 par la société FAIRMOUNT CHEMICAL de structure :

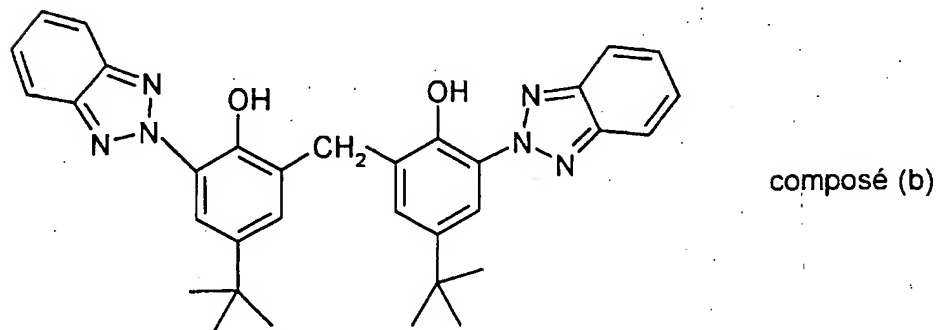
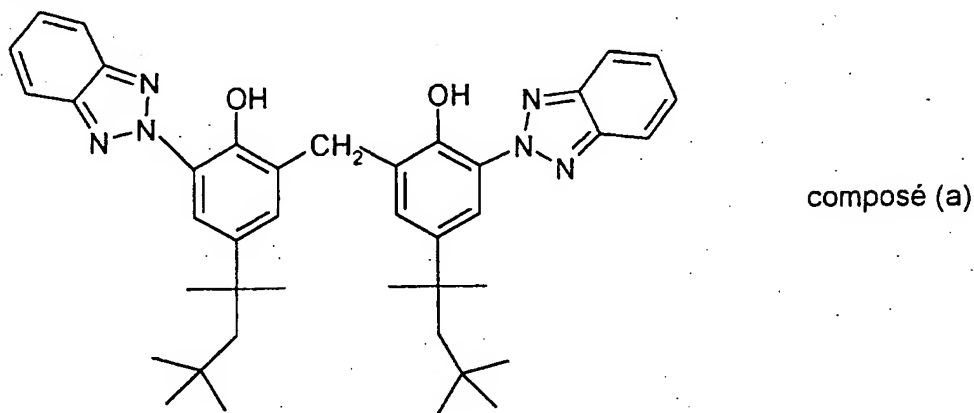


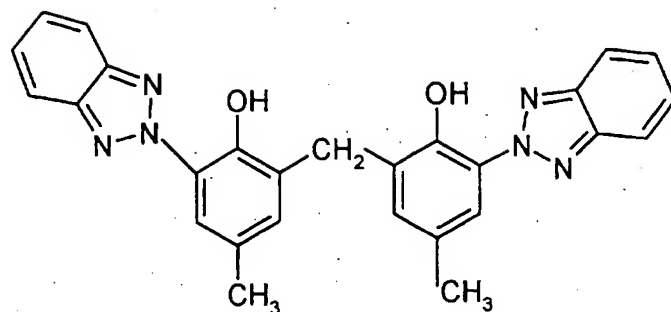
15. Parmi les filtres UV organiques hydrocarbonés dérivés d'hydroxybenzotriazole conformes à l'invention, on peut citer les dérivés de méthylène bis-(hydroxyphényl benzotriazole) de structure suivante :



- 5 dans laquelle les radicaux T_8 et T_9 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C_1 - C_{18} pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkyle en C_1 - C_4 , cycloalkyle en C_5 - C_{12} ou un reste aryle. Ces composés sont connus en soi et décrits dans les demandes US 5237 071, US 5 166 355, GB-A-2 303 549, DE 197 26 184 et EP-A-893 119 (faisant partie intégrante de la description).
- 10 Dans la formule (6) définie ci-dessus : les groupes alkyle en C_1 - C_{18} peuvent être linéaires ou ramifiés et sont par exemple méthyle, éthyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, tert-butyle, tert-octyle, n-amyle, n-hexyle, n-heptyle, n-octyle, iso-octyle, n-nonyle, n-décyle, n-undécyle, n-dodécyle, tétradécyle, hexydécyle, ou octadécyle ; les groupes cycloalkyle en C_5 - C_{12} sont par exemple cyclopentyle, cyclohexyle, cyclooctyle ; les
- 15 groupes aryle sont par exemple phényle, benzyle.

Parmi les composés de formule (6), on préfère plus particulièrement ceux de structure suivante :





composé (c)

5 Le composé (a) de nomenclature 2,2'-méthylène-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)phénol] est vendu sous le nom MIXXIM BB/100 par le société FAIRMOUNT CHEMICAL.

10 Le composé (c) de nomenclature 2,2'-méthylène-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(méthyl)phénol] est vendu sous le nom MIXXIM BB/200 par le société FAIRMOUNT CHEMICAL.

15 Selon une forme particulière de l'invention, les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole peuvent se présenter sous une forme particulière et être insolubles ou substantiellement insolubles dans les solvants usuels cosmétiques (eau, alcools, corps gras, etc).

20 Par composés insolubles ou substantiellement insolubles, on entend, au sens de la présente invention, des composés insolubles dans les milieux cosmétiques généralement utilisés dans les formulations solaires et plus particulièrement dont la solubilité dans l'eau à 25°C est inférieure à 0,1 % en poids et dont la solubilité dans l'huile de paraffine à 25°C est inférieure à 1% en poids.

25 Les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole peuvent être amenés sous une forme particulière convenable par tout moyen ad-hoc tel que notamment broyage à sec ou en milieu solvant, tamisage, atomisation, micronisation, pulvérisation.

30 Selon un mode particulier de l'invention, les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole peuvent se présenter sous forme insoluble micronisée. La taille moyenne de telles particules variera en général de 0,01 à 2µm et plus préférentiellement de 0,02 à 1,5 µm et plus particulièrement de 0,05 à 1,0 µm.

35 Les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole sous forme micronisée, peuvent être obtenus par un procédé de broyage d'un dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole sous forme de particules de taille grossière en présence d'un tensio-actif approprié permettant d'améliorer la dispersion des particules ainsi obtenues dans les formulations cosmétiques.

40 L'appareil de broyage utilisé peut être un broyeur à jet, à billes, à vibration ou à marteau et de préférence un broyeur à haute vitesse d'agitation ou un broyeur à impact et plus particulièrement un broyeur à billes rotatives, un broyeur vibrant, à broyeur à tube ou un broyeur à tige.

45 A titre de tensio-actifs utilisables pour le broyage desdits les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole, on peut citer en particulier les alkylpolyglucosides de structure $C_nH_{2n+1}O(C_6H_{10}O_5)_zH$ dans laquelle n est un entier de 8 à 16 et z est le degré moyen de polymérisation de l'unité $(C_6H_{10}O_5)$ et varie de 1,4 à 1,6.

- Ils peuvent être choisis parmi des esters en C₁-C₁₂ d'un composé de structure C_nH_{2n+1}O(C₆H₁₀O₅)₂H et plus précisément un ester obtenu par réaction d'un acide carboxylique en C₁-C₁₂ tel que l'acide formique, acétique, propionique, butyrique, sulfosuccinique, citrique ou tartrique avec une ou plusieurs fonctions OH libres sur l'unité glucoside (C₆H₁₀O₅). Lesdits tensio-actifs sont utilisés en général à une concentration de allant de 1 à 50% en poids et plus préférentiellement de 5 à 40% en poids par rapport au filtre dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole dans sa forme micronisée.
- Le ou les filtres du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole selon l'invention sont généralement présents dans les compositions selon l'invention à une concentration totale comprise entre 0,1 et 20 % en poids environ, et de préférence entre 0,5 et 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition.
- Les compositions cosmétiques antisolaires selon l'invention peuvent bien entendu contenir un ou plusieurs filtres organiques complémentaires actifs dans l'UVA et/ou l'UVB. Ces filtres complémentaires peuvent être notamment choisis parmi les dérivés cinnamiques ; les dérivés de dibenzoylméthane ; les dérivés salicyliques, les dérivés du camphre ; les dérivés de triazine tels que ceux décrits dans les demandes de brevet US 4367390, EP863145, EP517104, EP570838, EP796851, EP775698, EP878469 et EP 933376 ; les dérivés de la benzophénone ; les dérivés de β,β'-diphénylacrylate, les dérivés de benzimidazole ; les dérivés bis-benzoazole tels que décrits dans les brevets EP-A-0669323 et US 2,463,264 ; les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque ; les polymères filtres et silicones filtres tels que ceux décrits notamment dans la demande WO-93/04665.
- Comme exemples de filtres solaires complémentaires actifs dans l'UV-A et/ou l'UV-B, on peut citer :
- l'acide p-aminobenzoïque,
 - le p-aminobenzoate oxyéthyléné (25mol),
 - le p-diméthylaminobenzoate de 2-éthylhexyle,
 - le p-aminobenzoate d'éthyle N-oxypropyléné
 - le p-aminobenzoate de glycérol,
 - le salicylate d'homomenthyle,
 - le salicylate de 2-éthylhexyle,
 - le salicylate de triéthanolamine,
 - le salicylate de 4-isopropylbenzyle,
 - le 4-ter-butyl-4'-méthoxy-dibenzoylméthane,
 - le 4-isopropyl-dibenzoylméthane,
 - le 4-méthoxy cinnamate de 2-éthylhexyle,
 - le diisopropyl cinnamate de méthyle,
 - le 4-méthoxy cinnamate d'isoamyle,
 - le 4-méthoxy cinnamate de diéthanolamine,
 - l'anthranilate de menthyle,
 - le 2-éthylhexyl-2-cyano-3,3'-diphénylacrylate,
 - l'éthyl-2-cyano-3,3'-diphénylacrylate,
 - l'acide 2-phényl benzimidazole 5-sulfonique et ses sels,
 - le 3-(4'-triméthylammonium)-benzylidène-bornan-2-on-méthylsulfate,
 - le 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone,
 - le 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonate,
 - le 2,4-dihydroxybenzophénone,
 - le 2,2',4,4'-tétrahydroxybenzophénone,
 - le 2,2'-dihydroxy-4,4'-diméthoxybenzophénone,
 - le 2-hydroxy-4-n-octoxybenzophénone,
 - le 2-hydroxy-4-méthoxy-4'-méthylbenzophénone,

- l'acide α -(2-oxobom-3-ylidène)-tolyl-4-sulfonique et ses sels solubles
 le 3-(4'-sulfo)benzylidèn-boman-2-one et ses sels solubles,
 le 3-(4'méthylbenzylidène)-d,l-camphre,
 le 3-benzylidène-d,l-camphre,
 5 l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique) et ses sels solubles,
 l'acide urocanique,
 la 2,4,6-tris-[p-(2'-éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine,
 la 2-[p-(tertiobutylamido)anilino]-4,6-bis-[(p-(2'-éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino)-1,3,5-
 triazine,
 10 la 2,4-bis {[4-2-éthyl-hexyloxy]-2-hydroxy-phenyl}-6-(4-méthoxy-phenyl)-1,3,5-triazine ;
 le polymère de N-(2 et 4)-[(2-oxobom-3-ylidèn)méthyl] benzyl]-acrylamide,
 l'acide 1,4-bis-benzimidazolyl-phénylen-3,3',5,5'-tétrasulfonique et ses sels solubles
 les polyorganosiloxanes à fonction benzalmalonate
- 15 Les compositions selon l'invention peuvent également contenir des agents de bronzage
 et/ou de brunissage artificiels de la peau (agents autobronzants), tels que par exemple de
 la dihydroxyacétone (DHA).

- 20 Les compositions cosmétiques selon l'invention peuvent encore contenir des pigments ou
 bien encore des nanopigments (taille moyenne des particules primaires: généralement
 entre 5 nm et 100 nm, de préférence entre 10 nm et 50 nm) d'oxydes métalliques enrobés
 ou non comme par exemple des nanopigments d'oxyde de titane (amorphe ou cristallisé
 sous forme rutile et/ou anatase), de fer, de zinc, de zirconium ou de cérium qui sont tous
 des agents photoprotecteurs UV bien connus en soi. Des agents d'enrobage classiques
 25 sont par ailleurs l'alumine et/ou le stéarate d'aluminium. De tels nanopigments d'oxydes
 métalliques, enrobés ou non enrobés, sont en particulier décrits dans les demandes de
 brevets EP-A-0518772 et EP-A-0518773.

- 30 Les compositions de l'invention peuvent comprendre en outre des adjuvants cosmétiques
 classiques notamment choisis parmi les corps gras, les solvants organiques, les
 épaississants, les adoucissants, les opacifiants, les stabilisants, les émoullients, les agents
 anti-mousse, les agents hydratants, les parfums, les conservateurs, les polymères, les
 charges, les séquestrants, les propulseurs, les agents alcalinisants ou acidifiants ou tout
 autre ingrédient habituellement utilisé en cosmétique, en particulier pour la fabrication de
 35 compositions antisolaires sous forme d'émulsions.

- Les corps gras peuvent être constitués par une huile ou une cire ou leurs mélanges, et ils
 comprennent également les acides gras, les alcools gras et les esters d'acides gras. Les
 huiles peuvent être choisies parmi les huiles animales, végétales, minérales ou de
 40 synthèse et notamment parmi l'huile de vaseline, l'huile de paraffine, les huiles de
 silicone, volatiles ou non, les isoparaffines, les polyoléfines, les huiles fluorées et
 perfluorées. De même, les cires peuvent être choisies parmi les cires animales, fossiles,
 végétales, minérales ou de synthèse connues en soi.

- 45 Parmi les solvants organiques, on peut citer les alcools et polyols inférieurs.

- Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels composés
 complémentaires et/ou leurs quantités de manière telle que les propriétés avantageuses,
 en particulier la rémanence à l'eau, la stabilité, attachées intrinsèquement aux émulsions
 50 conformes à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les
 adjonctions envisagées.

- Les compositions de l'invention peuvent être préparées selon les techniques bien
 connues de l'homme de l'art, en particulier celles destinées à la préparation d'émulsions
 55 de type huile-dans-eau ou eau-dans-huile.

Ces compositions peuvent se présenter en particulier sous forme d'émulsion, simple ou complexe (H/E, E/H, H/E/H ou E/H/E) telle qu'une crème, un lait, un gel ou un gel crème, de poudre, de bâtonnet solide et éventuellement être conditionnée en aérosol et se présenter sous forme de mousse ou de spray.

Lorsqu'il s'agit d'une émulsion, la phase aqueuse de celle-ci peut comprendre une dispersion vésiculaire non ionique préparée selon des procédés connus (Bangham, Standish and Watkins. J. Mol. Biol. 13, 238 (1965), FR2315991 et FR2416008).

La composition cosmétique de l'invention peut être utilisée comme composition protectrice de l'épiderme humain ou des cheveux contre les rayons ultraviolets, comme composition antisolaire ou comme produit de maquillage.

Lorsque la composition cosmétique selon l'invention est utilisée pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons UV, ou comme composition antisolaire, elle peut se présenter sous forme d'une dispersion vésiculaire non ionique, d'une émulsion, en particulier d'une émulsion de type huile-dans-eau, d'une crème, d'un lait, d'un gel, d'un gel crème, d'une suspension, d'une dispersion, d'une poudre, d'un bâtonnet solide, d'une mousse ou d'un spray.

Lorsque la composition cosmétique selon l'invention est utilisée pour la protection des cheveux contre les rayons UV, elle peut se présenter sous forme de shampooing, de lotion, de gel, d'émulsion, de dispersion vésiculaire non ionique et constituer par exemple une composition à rincer, à appliquer avant ou après shampooing, avant ou après coloration ou décoloration, avant, pendant ou après permanente ou défrisage, une lotion ou un gel coiffants ou traitants, une lotion ou un gel pour le brushing ou la mise en plis, une composition de permanente ou de défrisage, de coloration ou décoloration des cheveux.

Lorsque la composition est utilisée comme produit de maquillage des cils, des sourcils ou de la peau, tel que crème de traitement de l'épiderme, fond de teint, bâton de rouge à lèvres, fard à paupières, fard à joues, mascara ou ligneur encore appelé "eye liner", elle peut se présenter sous forme solide ou pâteuse, anhydre ou aqueuse, comme des émulsions huile dans eau ou eau dans huile, des dispersions vésiculaires non ioniques ou encore des suspensions.

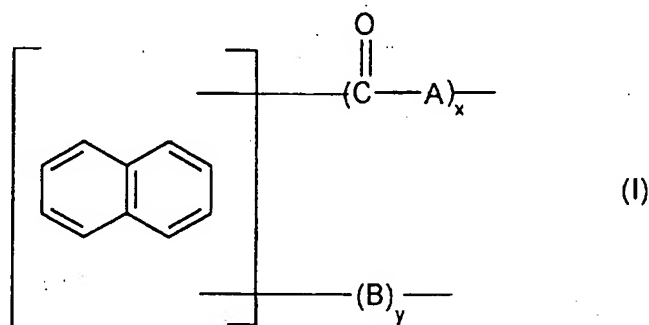
A titre indicatif, pour les formulations antisolaires conformes à l'invention qui présentent un support de type émulsion huile-dans-eau, la phase aqueuse (comprenant notamment les filtres hydrophiles) représente généralement de 50 à 95% en poids, de préférence de 70 à 90% en poids, par rapport à l'ensemble de la formulation, la phase huileuse (comprenant notamment les filtres lipophiles) de 5 à 50% en poids, de préférence de 10 à 30% en poids, par rapport à l'ensemble de la formulation, et le ou les (co)émulsionnant(s) de 0,5 à 20% en poids, de préférence de 2 à 10% en poids, par rapport à l'ensemble de la formulation.

Un exemple concret, mais nullement limitatif, illustrant l'invention, va maintenant être donné.

COMPOSITION	% en poids
Mélange mono /distearate de glycerol / stéarate de polyéthylène glycol (100 OE) (ARLACEL 165 FL - ICI)	2
Alcool stearylque (LANETTE 18 - HENKEL)	1
Acide stéarique d'huile de palme (STEARINE TP - STEARINERIE DUBOIS)	2.5
poly dimethylsiloxane (DOW CORNING 200 FLUID - DOW CORNING)	0.5
Benzoate d'alcools en C12/C15 (WITCONOL TN -WITCO)	20
Triéthanolamine	0.5
Méthylène bis-(tetramethylbutyl hydroxyphenyl benzotriazole)	5
Glycérine	5
Phosphate d'alcool hexadecylique, sel de potassium (AMPHISOL K - HOFFMAN LAROCHE)	1
Acide polyacrylique (SYNTHALEN K - 3V)	0.3
Hydroxypropyl methyl cellulose (METHOCEL F4M -DOW CHEMICAL)	0.1
Butyl methoxydibenzoyl methane (Parsol 1789 ; GIVAUDAN)	2
Dérivé d'acide naphthalène dicarboxylique à terminaison glycol et alcool proposé sous la dénomination HALLBRITE TQ par la société CP HALL)	4
Drométrizole Trisiloxane (SILATRIZOLE -RHODIA CHIMIE)	3
Triethanolamine	qs pH 7
Conservateurs	qs
Eau déminéralisée qsp	100 g

REVENDECATIONS

1. Composition cosmétique ou dermatologique, en particulier antisolaire, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétiquement acceptable :
- 5 (c) au moins un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et
 (d) au moins un système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au moins un filtre UV organique du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole.
2. Composition selon la revendication 1, où le ou les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique sont choisis parmi les composés comprenant au moins un motif répondant à la structure suivante :
- 10



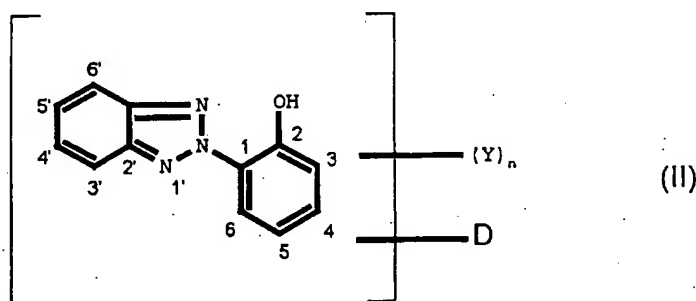
- 15 dans laquelle :
- A, identiques ou différents, désignent un groupe OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un cation M
 x est un nombre de 1 à 8 ;
 y est un nombre de 0 à 7 avec $x+y \leq 8$;
- 20 B, identiques ou différents, désignent hydrogène, OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un groupe
 $-(C=O)R_1$;
 R_1, R_2, R_3 , identiques ou différents, désignent hydrogène ; un alkyle en C_1-C_{30} , linéaire ou ramifié acyclique ou cyclique, éventuellement interrompu par un ou plusieurs hétéroatomes et éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un alcényle en C_2-C_{30} , linéaire ou ramifié acyclique ou cyclique, éventuellement interrompu par un ou plusieurs hétéroatomes (tels que O, S, N) et éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un groupement aryle, aralkyle ou alkylaryle en C_6-C_{30} , éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un hétérocycle en C_3-C_{12} , éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un
- 25 halogène (tel que fluor, brome ou chlore) ; un groupe nitrile ; un groupe amino ; un
 30 groupe nitro ; un groupe cyano ; un groupe SO_3H ou SO_3M ; un groupement comportant au moins un atome de silicium ;
 M représente un cation de métal alcalin, de métal alcalino-terreux, un groupe ammonium ou un reste d'amine ou d'alcanolamine quaternisée.
- 35
3. Composition selon la revendication 1 ou 2, où le ou les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique sont choisis dans le groupe constitué par :
- (1) les acides naphthalène mono- ou polycarboxyliques et leurs sels ;
 (2) les mono- ou polyesters d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et leurs sels ;
 40 (3) les mono- ou polyamides d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et leurs sels ; diamide de l'acide 2,3-naphthalène dicarboxylique et leurs sels.
- 45

4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, où le ou les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique sont des dérivés d'acide naphthalène dicarboxylique à terminaisons glycols et alcools.

5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, où le ou les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique présents dans les compositions selon l'invention à une concentration totale comprise entre 0,1 et 20 % en poids environ, et de préférence entre 0,5 et 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition.

5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, où le ou les filtres UV du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole sont siliciés ou bien hydrocarbonés.

6. Composition selon la revendication 5, où le ou les filtres UV siliciés d'hydroxyphénylbenzotriazole, sont choisis parmi ceux répondant à la formule (II) suivante :



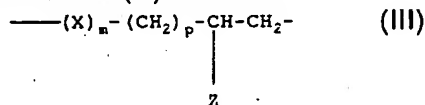
dans laquelle :

- D désigne un radical divalent -L-W-

- Y, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en C₁-C₁₀, les halogènes, les radicaux alkoxy en C₁-C₁₀, des groupes sulfoniques, étant entendu que, dans ce dernier cas, deux Y adjacents d'un même noyau aromatique peuvent former ensemble un groupement alkylidène dioxy dans lequel le groupe alkylidène contient de 1 à 2 atomes de carbone ; sous réserve que les radicaux Y soient différents d'un groupe sulfonique quand D est différent d'hydrogène ;

- n vaut 1, 2 ou 3 ;

- L est un radical divalent de formule (III) suivante :



dans laquelle :

- X représente O ou NH,

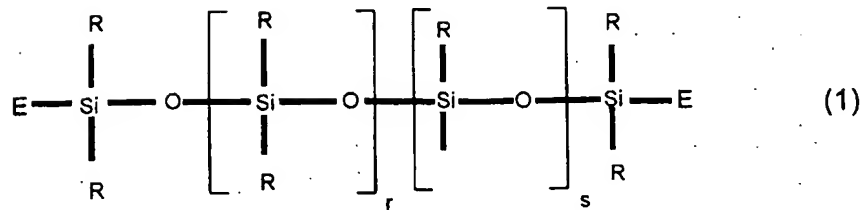
- Z représente l'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄,

- n est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclusivement,

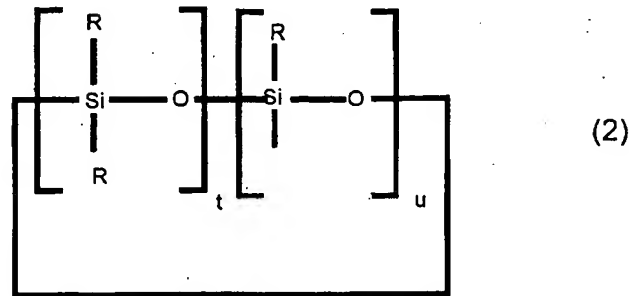
- m est 0 ou 1,

- p représente un nombre entier compris entre 1 et 10, inclusivement.

- W est un radical de formule (1), (2) ou (3) suivante :



ou



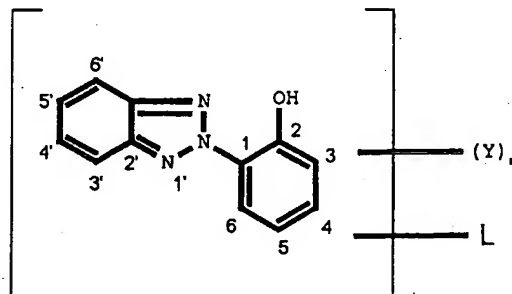
ou



dans lesquelles :

- R, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en C₁-C₁₀, phényle et trifluoro-3,3,3 propyle, au moins 80% en nombre des radicaux R étant méthyle,

10 - E, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux R et le radical V de formule suivante :



dans laquelle Y, n et L ont les mêmes significations indiquées ci-dessus ;

15 - r est un nombre entier compris entre 0 et 50 inclusivement, et s est un nombre entier compris entre 1 et 20 inclusivement, et si s=0 au moins l'un des deux radicaux B désigne V ;

- u est un nombre entier compris entre 1 et 6 inclusivement, et t est un nombre entier compris entre 0 et 10 inclusivement, étant entendu que t + u est égal ou supérieur à 3.

20 7. Composition selon la revendication 6, selon laquelle le ou les filtres UV de formule (II) sont des polyorganosiloxanes linéaires et W répond à la formule (1).

8. Composition selon la revendication 7, selon laquelle le ou les filtres UV de formule (II) sont des polyorganosiloxanes linéaires statistiques ou blocs présentant au moins l'une

25 des caractéristiques suivantes :

- R est alkyle

- E est alkyle et encore plus préférentiellement est méthyle,

- r est compris entre 0 et 15 inclusivement ; s est compris entre 1 et 5 inclusivement,

- n est non nul, et de préférence égal à 1, et Y est alors choisi parmi méthyle, ter.-butyle ou alcoxy en C₁-C₄,
- Z est hydrogène ou méthyle,
- m=0, ou [m=1 et X=O]
- 5 - p est égal à 1.

9. Composition selon la revendication 8, selon laquelle le ou les filtres UV de formule (II) sont des polyorganosiloxanes linéaires statistiques ou blocs présentant l'ensemble des caractéristiques énoncées dans la revendication 8.

10. Composition selon la revendication 7 ou 8, selon laquelle le ou les filtres UV de formule (II) sont des polyorganosiloxanes linéaires statistiques ou blocs présentant au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- R est méthyle,
- 15 - E est méthyle,
- r est compris entre 0 et 15 inclusivement ; s est compris entre 1 et 5 inclusivement,
- n est égal à 1, et Y est alors choisi parmi méthyle, ter.-butyle ou alcoxy en C₁-C₄,
- Z est hydrogène ou méthyle,
- m=0, ou [m=1 et X=O]
- 20 - p est égal à 1.

11. Composition selon la revendication 10, selon laquelle le ou les filtres UV de formule (II) sont des polyorganosiloxanes linéaires statistiques ou blocs présentant l'ensemble des caractéristiques énoncées dans la revendication 10.

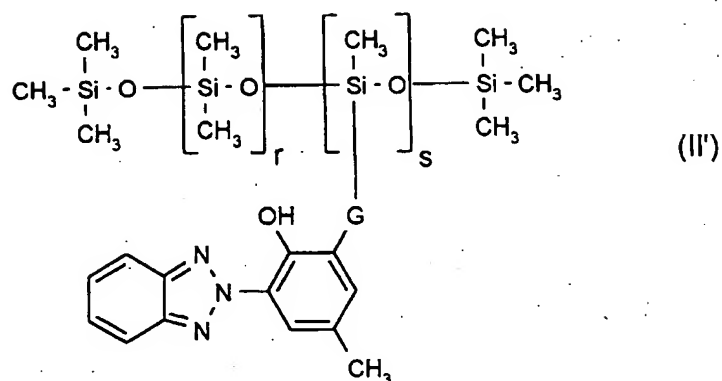
12. Composition selon l'une quelconque des revendications 6 à 11, selon laquelle pour les composés de formule (II), l'accrochage du chaînon $-(X)_m-(CH_2)_p-CH(Z)-CH_2-$ sur le motif hydroxyphénylbenzotriazole se fait en position 3, 4, 5 ou 4'.

13. Composition selon la revendication 12, selon laquelle pour les composés de formule (II), l'accrochage du chaînon $-(X)_m-(CH_2)_p-CH(Z)-CH_2-$ sur le motif hydroxyphénylbenzotriazole se fait en position 3, 4 ou 5.

14. Composition selon la revendication 13, selon laquelle pour les composés de formule (II), l'accrochage du chaînon $-(X)_m-(CH_2)_p-CH(Z)-CH_2-$ sur le motif hydroxyphénylbenzotriazole se fait en position 3.

15. Composition selon l'une quelconque des revendications 6 à 14, selon laquelle pour les composés de formule (II), l'accrochage du motif substituant Y se fait en position 3, 4, 4', 5 et/ou 6 et de préférence en position 5.

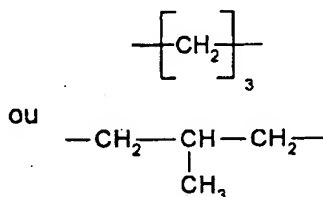
16. Composition selon l'une quelconque des revendications 6 à 15, le composé de formule (II) a comme structure :



avec $0 \leq r \leq 15$, de préférence $0 \leq r \leq 10$
 $1 \leq s \leq 5$, de préférence $1 \leq s \leq 3$

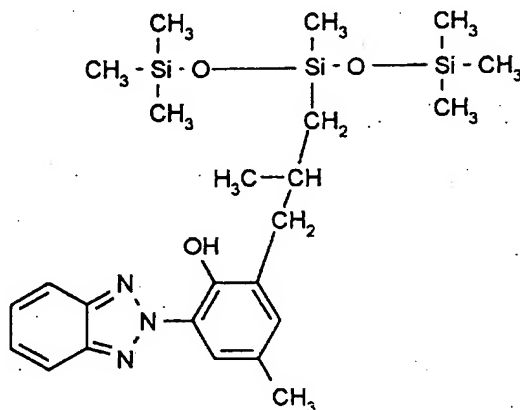
5

et G représente l'un des radicaux divalents suivants :



10

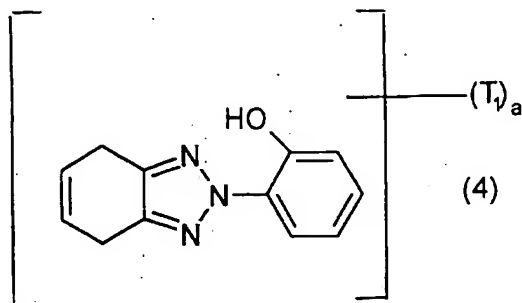
17. Composition selon la revendication 16, où le composé de formule (II') a comme structure est le composé de structure :



15

18. Composition selon l'une quelconque des revendications 6 à 17, selon laquelle le ou les dérivés hydrocarbonés d'hydroxyphénylbenzotriazole sont choisis parmi composés répondant à la formule suivante (4) :

20

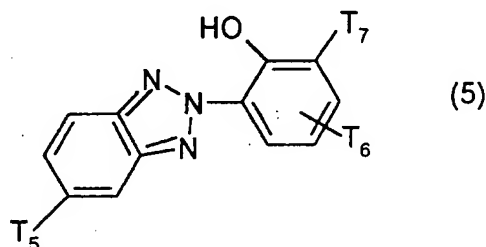


5 dans laquelle a vaut 1, 2 ou 3 et les radicaux T_1 , identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en C_1-C_{18} , les halogènes, des groupes sulfoniques, les radicaux alkoxy en C_1-C_{18} , étant entendu que, dans ce dernier cas, deux T_1 adjacents d'un même noyau aromatique peuvent former ensemble un groupement alkylidène dioxy dans lequel le groupe alkylidène contient de 1 à 2 atomes de carbone.

10 19. Composition selon la revendication 18, où les composés de formule (4) sont choisis parmi :

- le 2-(2'-hydroxy-5'-méthylphényl)benzotriazole ;
- le 2-(2'-hydroxy-3'-butyl-5'-méthylphényl)benzotriazole ;
- le 2-(2'-hydroxy-5'-t-octylphényl)benzotriazole ;
- le 2-(2'-hydroxy-3'-sec-butyl-5'-benzènesulfonate)benzotriazole.

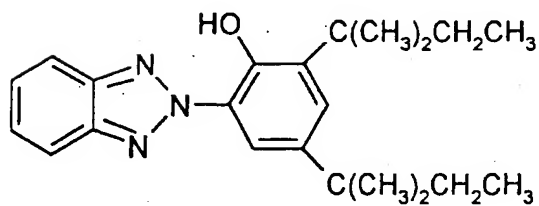
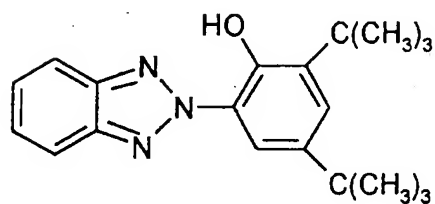
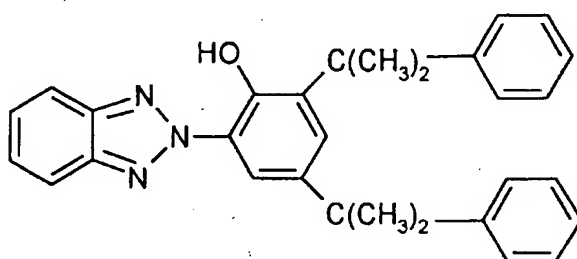
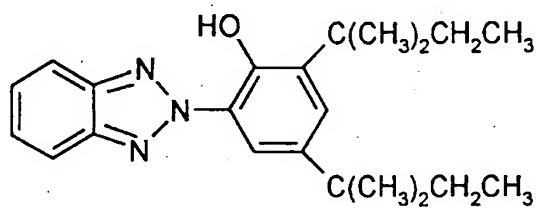
15 20. Composition selon l'une quelconque des revendications 6 à 17, selon laquelle le ou les dérivés hydrocarbonés d'hydroxyphénylbenzotriazole sont choisis parmi ceux de formule suivante (5) :



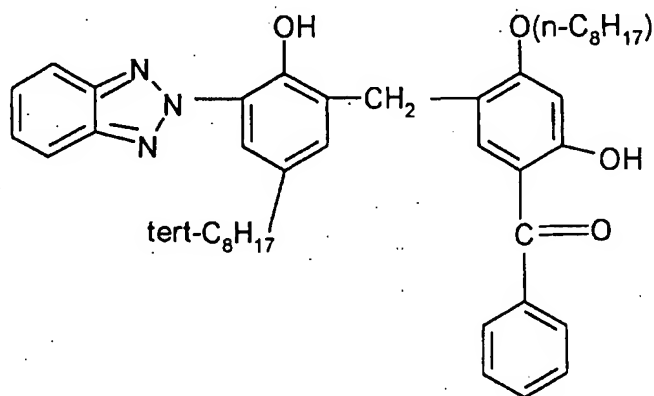
20 dans laquelle T_5 désigne un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_{18} ; T_6 et T_7 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C_1-C_{18} éventuellement substitué par un phényle.

21. Composition selon la revendication 20, où les composés de formule (5) sont choisis parmi les composés suivants :

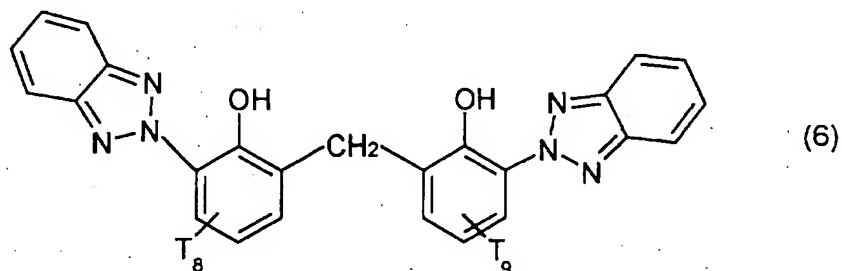
5



22. Composition selon l'une quelconque des revendications 6 à 17, selon laquelle le dérivé hydrocarboné d'hydroxyphénylbenzotriazole est le [2,4'-dihydroxy-3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-2'-n-octoxy-5'-benzoyl] diphénylméthane de structure :



23. Composition selon l'une quelconque des revendications 6 à 17, selon laquelle le ou les dérivés hydrocarbonés d'hydroxybenzotriazole sont choisis parmi les dérivés de méthylène bis-(hydroxyphényl benzotriazole) de structure suivante :

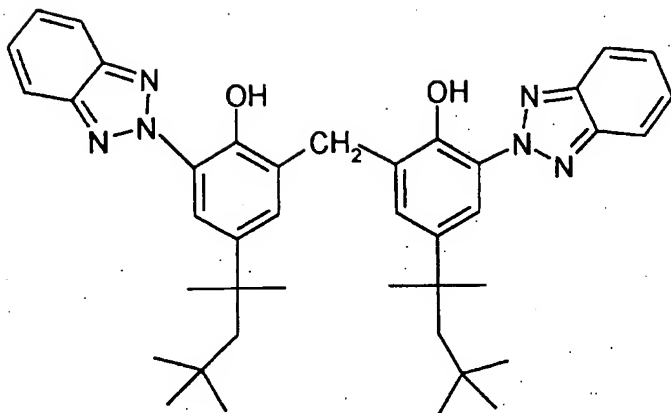


10

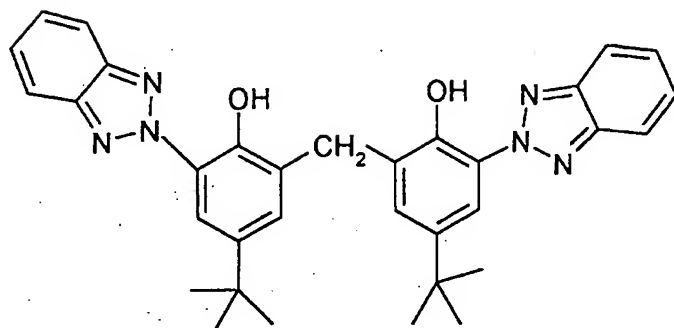
dans laquelle les radicaux T_8 et T_9 , identiques ou différents, désignent un radical alkyle en C_1 - C_{18} pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkyle en C_1 - C_4 , cycloalkyle en C_5 - C_{12} ou un reste aryle.

15

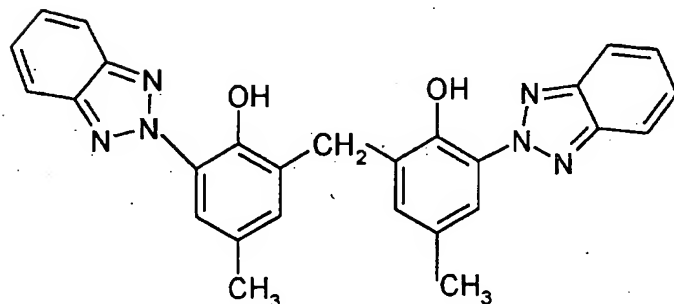
24. Composition selon la revendication 23, selon laquelle le composé de formule (6) est choisi parmi les composés de structure suivante :



composé (a)



composé (b)



composé (c)

5

25. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 24, selon laquelle les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole se présentent sous une forme particulière et sont insolubles ou substantiellement insolubles dans les solvants usuels cosmétiques.

10

26. Composition selon la revendication 25, où les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole se présentent sous forme insoluble micronisée.

15

27. Composition selon la revendication 25 ou 26, où les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole sont sous forme de particules de taille moyenne allant de 0,01 à 2µm.

20

28. Composition selon la revendication 27, où les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole sont sous forme de particules de taille moyenne allant de 0,02 à 1,5 µm.

29. Composition selon la revendication 28, où les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole sont sous forme de particules de taille moyenne allant de 0,05 à 1,0 μm .

30. Composition selon l'une quelconque des revendications 25 à 29, où les dérivés d'hydroxyphénylbenzotriazole sous forme micronisée sont susceptibles d'être obtenus par un procédé de broyage d'un dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole sous forme de particules de taille grossière en présence d'un tensio-actif.

31. Composition selon la revendication 30, où le tensio-actif est choisi parmi les alkylpolyglucosides de structure $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_z\text{H}$ dans laquelle n est un entier de 8 à 16 et z est le degré moyen de polymérisation de l'unité ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$) et varie de 1,4 à 1,6.

32. Composition selon l'une quelconque des revendications 30 et 31, caractérisée par le fait que le tensio-actif est utilisé à une concentration allant de 1 à 50% en poids par rapport au dérivé d'hydroxyphényl benzotriazole dans sa forme micronisée.

33. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 32, caractérisée par le fait que le ou les filtres du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole sont présents dans une concentration allant de 0,1 à 20 % en poids environ, et de préférence entre 0,5 à 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition.

34. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 33, caractérisée par le fait que ledit support cosmétiquement acceptable se présente sous la forme d'une émulsion de type huile-dans-eau.

35. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 34, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre un ou plusieurs filtres organiques complémentaires actifs dans l'UV-A et/ou UV-B.

36. Composition selon la revendication 29, caractérisée par le fait que lesdits filtres organiques complémentaires sont choisis parmi les dérivés cinnamiques ; les dérivés de dibenzoylméthane ; les dérivés salicyliques, les dérivés du camphre ; les dérivés de triazine ; les dérivés de la benzophénone ; les dérivés de β,β' -diphénylacrylate, les dérivés de benzimidazole ; les dérivés bis-benzoazole ; les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque ; les polymères filtres et silicones.

37. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 36, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre, à titre d'agents photoprotecteurs UV complémentaires, des pigments ou des nanopigments d'oxydes métalliques, enrobés ou non.

38. Composition selon la revendication 37, caractérisée par le fait que lesdits pigments ou nanopigments sont choisis parmi les oxydes de titane, de zinc, de fer, de zirconium, de cérium et leurs mélanges, enrobés ou non.

39. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 38, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un agent de bronzage et/ou de brunissage artificiel de la peau.

40. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 39, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un adjuvant choisi parmi les corps gras, les solvants organiques, les épaississants, les adoucissants, les opacifiants, les stabilisants, les émoullients, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les parfums, les conservateurs, les polymères, les charges, les séquestrants, les propulseurs, les agents alcalinisants ou acidifiants.

41. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 40, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition protectrice de l'épiderme humain ou d'une composition antisolaire et qu'elle se présente sous forme d'une dispersion vésiculaire non ionique, d'une émulsion, en particulier d'une émulsion de type huile-dans-eau, d'une crème, d'un lait, d'un gel, d'un gel crème, d'une suspension, d'une dispersion, d'une poudre, d'un bâtonnet solide, d'une mousse ou d'un spray.
42. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 40, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition de maquillage des cils, des sourcils ou de la peau et qu'elle se présente sous forme solide ou pâteuse, anhydre ou aqueuse, d'une émulsion, d'une suspension ou d'une dispersion.
43. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 40, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition destinée à la protection des cheveux contre les rayons ultraviolets et qu'elle se présente sous la forme d'un shampooing, d'une lotion, d'un gel, d'une émulsion, d'une dispersion vésiculaire non ionique.
44. Utilisation de la composition définie selon l'une quelconque des revendications 1 à 43 pour la fabrication de compositions cosmétiques pour la protection de la peau et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire.
45. Utilisation d'un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique dans la préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique photoprotectrice comprenant au moins un filtre UV organique du type dérivé d'hydroxyphénylbenzotriazole tel que défini dans les revendications précédentes, dans le but d'augmenter son niveau de protection vis à vis des effets induits par les radiations UV-A